

CREATIVE & INNOVATION

GLOBAL NO.1 HIGH-TECH SOLUTION PROVIDER

Disclaimer

본 자료는 주식회사 저스템(이하 “회사”)의 재정 상황, 운영·영업성과 및 회사 경영진의 계획·목표와 관련된 향후 전망을 포함하고 있습니다. 그러한 향후 전망은 회사의 실제 성과에 영향을 줄 수 있는 알려지지 않은 위험과 불확실성, 그리고 다른 요인들에 의해 변경될 수 있습니다.

회사는 본 자료에 포함된 정보의 정확성과 완벽성에 대해서 암묵적 또는 명시적으로 보장할 수 없으며, 본 자료에 서술된 내용은 과거 또는 미래에 대한 약속이나 진술로 간주될 수 없습니다.

따라서, 본 자료는 투자자들의 투자 결과에 대하여 어떠한 법적인 목적으로 사용되어서는 안되며, 회사는 본 자료에서 제공되는 정보에 의거하여 발생하는 투자 결과에 대해 어떠한 책임이나 손해 또는 피해를 지지 않음을 알려드립니다.

본 자료는 작성일 현재 시점의 정보에 기초하여 작성된 것이며, 회사는 향후 변경되는 새로운 정보나 미래의 사건에 대해 공개적으로 현행화 할 책임이 없습니다.

CREATIVE & INNOVATION
GLOBAL NO.1 HIGH-TECH SOLUTION PROVIDER

INVESTOR RELATIONS 2023

TABLE OF CONTENTS

01_ Company Overview

02_ 주요 사업군 사업 현황 : 반도체

03_ Business Performance

04_ 신규 사업 진행 현황

Appendix

CREATIVE & INNOVATION

GLOBAL NO.1 HIGH-TECH SOLUTION PROVIDER



01

Investor Relations 2023

Company Overview

01. Corporate Identity
02. 회사개요
03. 연구개발 역량
04. 원천기술 및 활용
05. 원천기술기반 성장스토리
06. 사업 영역



반도체 습도제어 솔루션 Global No.1 강소기업
IT & Energy 솔루션 Provider



업계 최고의 솔루션 보유

반도체 습도제어 솔루션 Global No.1

- 국내·외 IDM업체 점유율 1위
- 세계최초 기류제어 시스템 개발(JFS)
- N2 LPM System 100여종 개발
- 습도제어 솔루션 CAGR 35.3% (2016 ~2021 매출액)

업계 최고의 R&D 역량

- 특허 수 132건 확보
- 첨단산업 노하우를 보유한 연구진 보유

글로벌 Top-tier 고객사 확보

반도체

SAMSUNG

SK 하이닉스

Micron

HPSP
High Pressure Solution Provider

디스플레이 / 2차전지 / 태양광

LG디스플레이

LG전자

Hanwha

독보적 기술 기반 성장동력 확보

핵심 공정 기술 기반
첨단 산업 모든 분야 대응 가능



회사개요

글로벌 첨단산업 수율개선 핵심 기업, 저스텝



회사개요

회사명	주식회사 저스텝
대표이사	임영진
업종	반도체, 디스플레이 부품 제조 및 생산
설립일	2016년 4월 25일
자본금	3,536백만 원
종업원	100명('23년 03월 現)
본사 및 공장	경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 57
주요 고객	삼성전자, SK 하이닉스, 마이크론
영업 Agency	중국, 대만, 싱가포르, 일본, 미국

대표이사 소개



임영진 대표이사 (금속공학 박사)

- 2009.04 지식경제부/한국산업기술진흥원 국무총리상 수상
- 2019.12 무역의 날 대통령 표창수상
- 2020.03 상공의 날 산업통상부 장관 표창수상

주요 인프라 현황

● 본사 ● 삼성전자 CS 사무소 ● SK 하이닉스 CS 사무소



연구개발 역량

첨단산업 수율개선 글로벌 핵심 기업으로 성장하는 저스템



- 시스템 개발 / 신제품 개발 / 기술 기획 직군 인력 보유
- R&D 인력 반도체, 디스플레이 장비 경력 평균 11.1년으로 선제적 니즈 파악 및 솔루션 개발 역량
- 태양광, 2차전지 등 신성장 산업 개발 경력 보유 인력 확보

첨단산업 공정 내
최적의 Solution 공급

<h3>연구소장</h3> <ul style="list-style-type: none"> • 반도체 진공 장비 개발 10년 • 대면적 PECVD 개발 10년 • LCD 진공 로봇 개발 3년 • 열처리 장비 제조, Service 7년 • 저스템 연구 개발 총괄 	<h3>책임연구원</h3> <ul style="list-style-type: none"> • 대면적 PECVD 장비 설계/개발 11년 • OLED 증착라인 개발 5년 • 열, 진공, 플라즈마 시스템 개발 6년 	<h3>책임연구원</h3> <ul style="list-style-type: none"> • OLED 증착 장비 설계 9년 • PECVD 장비 설계 8년 • 진공 장비 설계 7년 • 진공, 유체 제어 시스템 설계 3년
<h3>책임연구원</h3> <ul style="list-style-type: none"> • Screw Compressor 개발 9년 • 반도체/LCD용 진공챔버 설계 및 생산 기술 4년 • 반도체/LED/SOLAR 부품 개발 3년 • FPD Glass 물류 장비 개발 2년 • 플라즈마 열처리장비 개발 	<h3>책임연구원</h3> <ul style="list-style-type: none"> • 디스플레이 공정 개발 2년 • PECVD 장비 개발 12년 • 유기막 증착 장비 개발 4년 • 진공, 유체 제어 시스템 개발 4년 • 제67회 대한민국 엔지니어 대상 	<h3>책임연구원</h3> <ul style="list-style-type: none"> • LCD Dry Etcher 제어 시스템 개발 4년 • OLED Fast ALD, 증착기 제어 개발 3년 • 진공 반송 제어 시스템 개발 3년 • Furnace 공정 개조 시스템 개발 2년 • Load Port 제어 시스템 개발 6년 • 체외 진단키트 자동화 시스템 개발

반도체, 디스플레이, 신성장 산업 경력이 풍부한 기술인력기반 핵심기술 내재화



기술 특허 확보,
진입장벽 구축

특허 수 132건

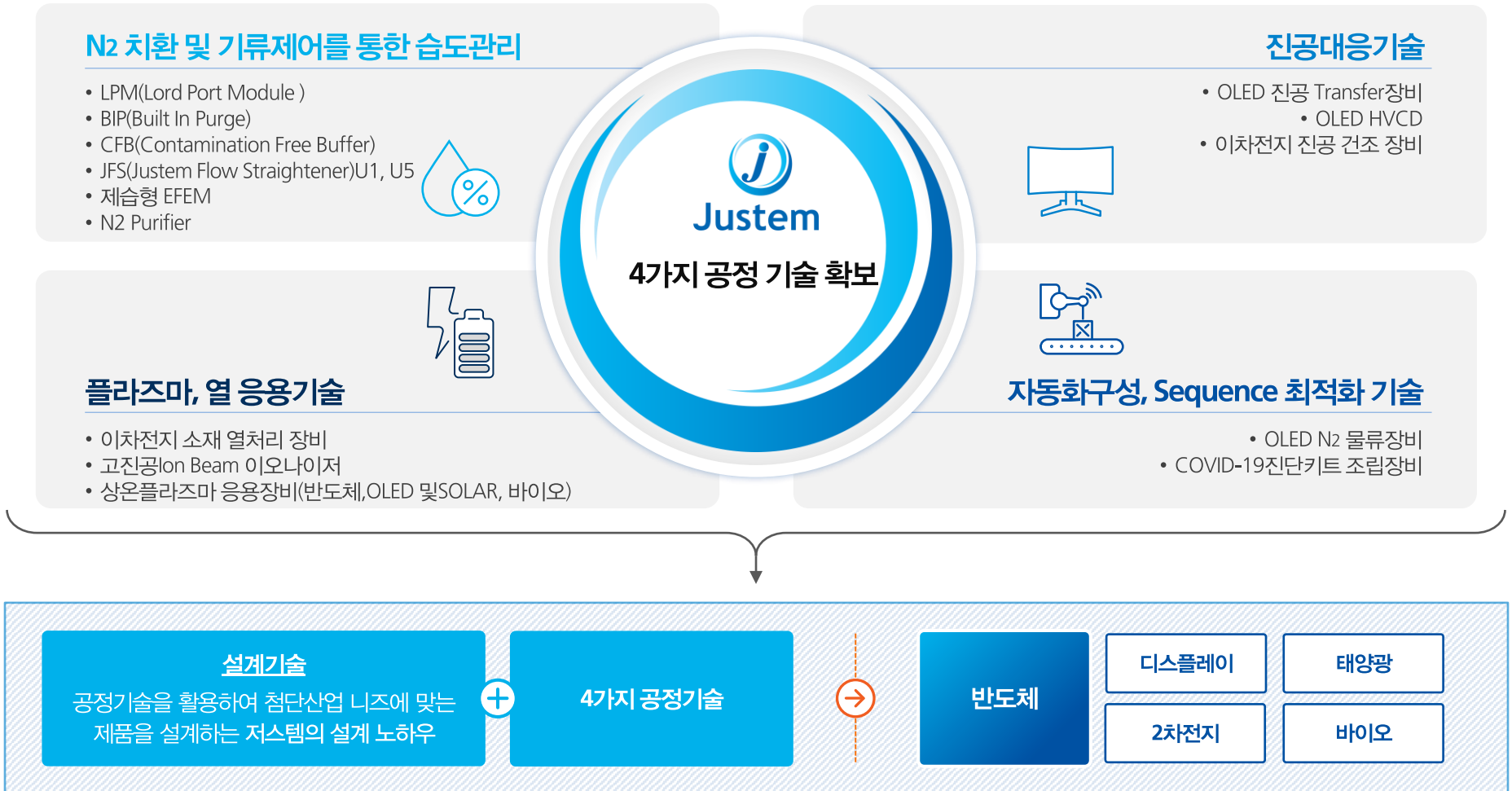
등록 수 41건

출원 91건

해외 14건

원천기술 및 활용

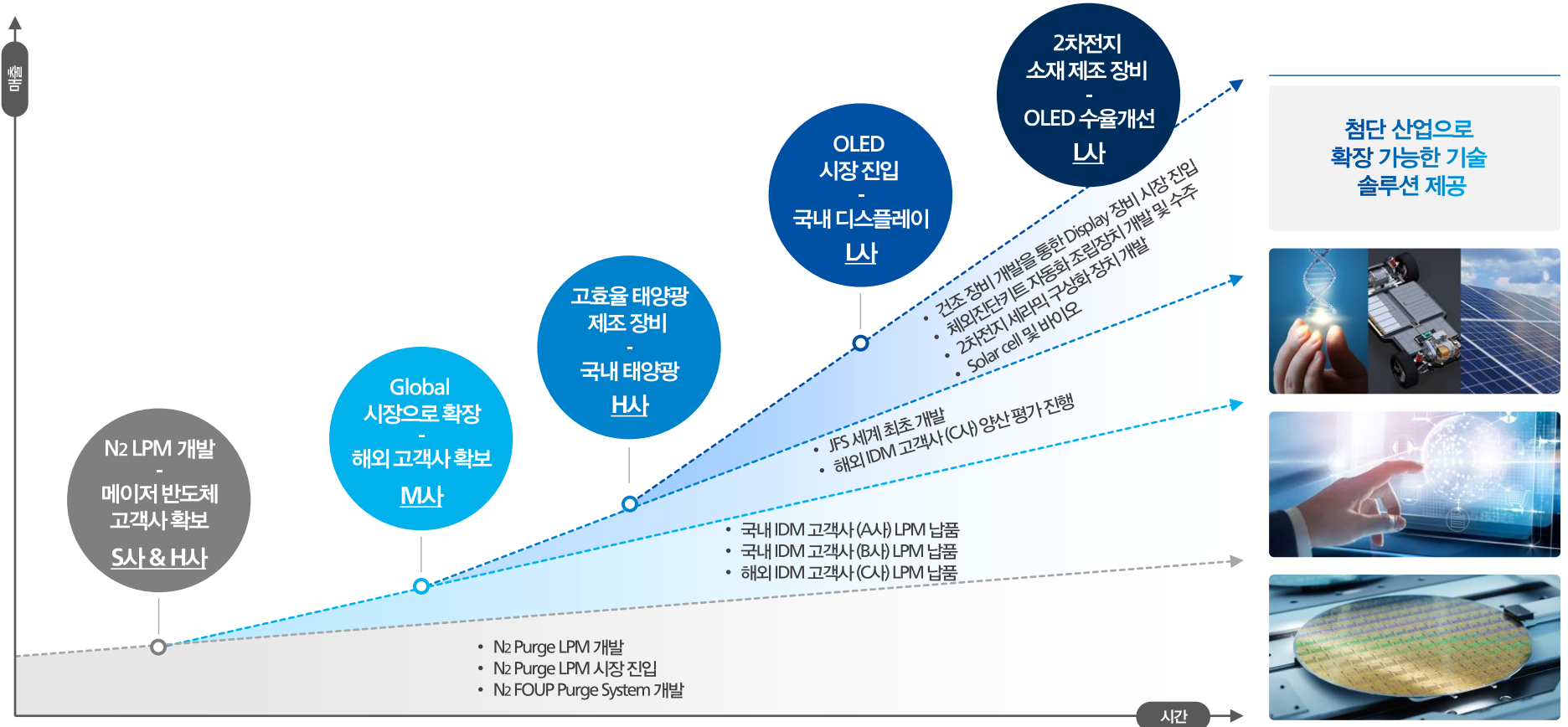
융복합 공정 기술 및 설계 기술 노하우를 보유한 IT & Energy 솔루션 Provider



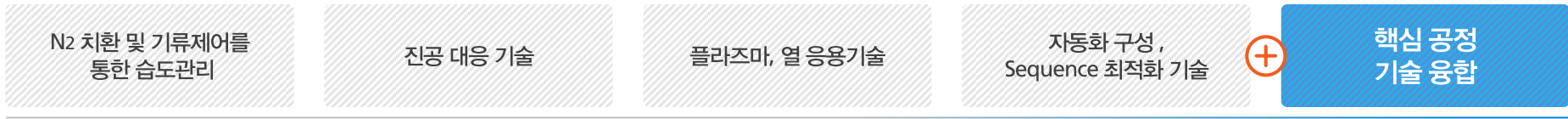
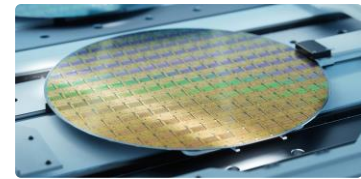
원천기술기반 성장스토리



4가지 핵심 공정기술 기반 첨단산업 솔루션 제공 기업으로 성장



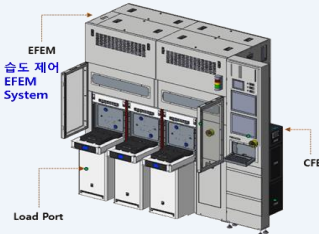
첨단 산업으로 확장 가능한 기술 솔루션 제공



기술 경쟁력을 통해 반도체 / 디스플레이 / 태양광 / 2차전지 산업 내 다양한 사업 포트폴리오 구축

주요 사업 영역

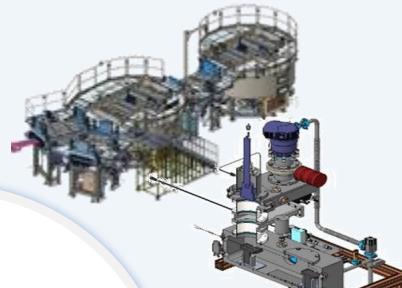
반도체



반도체 질소 순환 솔루션

- N2 Purge System (LPM, BIP, CFB)
- JFS U1, U5
- 제습EFEM

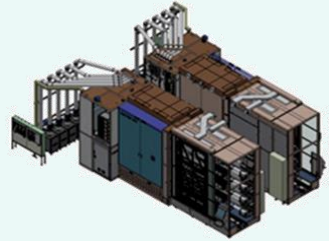
디스플레이



대면적 OLED 제조용 고진공 장비

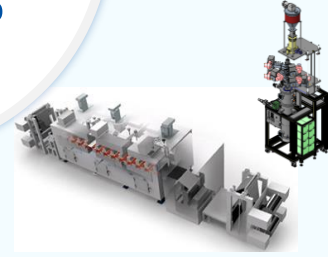
- 10.5G OLED 用 HVCD 장비
- OLED용 진공 Transfer 장비
- OLED N2 Transfer 장비
- N2 급속 치환 장치
- 6.5GH 고진공 환경 제조 장치

OLED 고진공 제전장치/MS



태양광 증착용 PECVD


- PECVD
- RPCVD
- POCL



2차전지 열처리 장비

- 음극재 및 분리막용 세라믹 소성 소재
- 반도체 코팅 및 방열 소재
- 소스 적층형 열처리 장비

고온 Aging 공정 장비



Justem

주요 제품 Line-up

태양광

2차전지

CREATIVE & INNOVATION

GLOBAL NO.1 HIGH-TECH SOLUTION PROVIDER



02

Investor Relations 2023

주요 사업군 사업 현황 : 반도체

01. 반도체 공정 내 N2 Purge System의 중요성(1)
반도체 공정 내 N2 Purge System의 중요성(2)
02. 제품 포트폴리오
03. 반도체 산업 고도화에 따른 수혜
04. 신규투자에 따른 수혜 전망

반도체 공정 내 N2 Purge System의 중요성(1)

반도체 전공정 전반에서 수율에 직접적인 영향을 미치는 습도 제어에 대한 중요성 증가



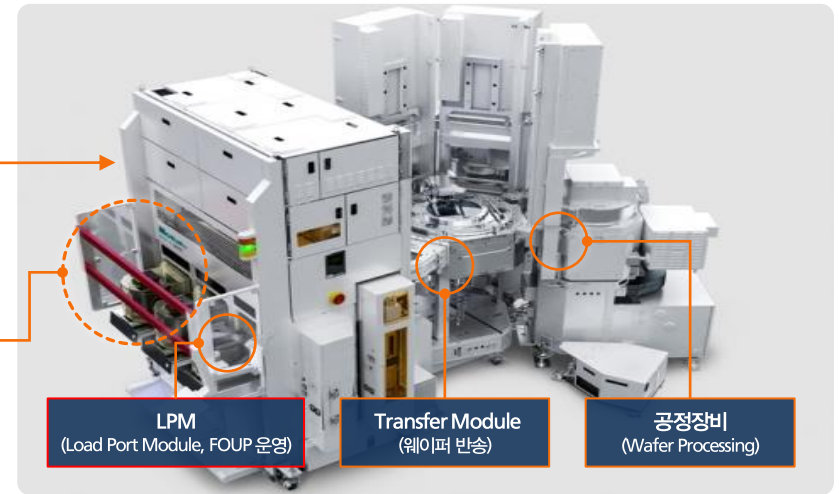
반도체 공정 Fab. : FOUP을 통해 공정간 웨이퍼 이송



웨이퍼를 외부 오염 및 습도로부터 보호 및 보관하는 용기 공정간 이송 시 사용되어 수율에 직접적인 영향

웨이퍼

반도체 공정 장비 : 웨이퍼 이송 → 오염원이 없는 청정 상태 유지 필수



반도체 Clean Class 1 한계 도달

Class 1 (0.5 μ m 이상, $\leq 1ea/ft^3$)	습도 40%~50%	온도 23~25°C
--	---------------	---------------

반도체 공정 내 N2 Purge System의 중요성(2)

반도체 수율 개선을 위한 최적의 선택지 N₂ Purge System

기존 LPM 습도 제어의 한계 발생

기존 LPM

기존 LPM 습도 : 45%

- 공정 미세화에 따른 기존 LPM의 45% 습도 유지 한계 발생
- 반도체 수율에 악영향을 미치는 고습도 환경 조성



미세화된 공정 내 습도로 인한 소자 손실 발생

Cu Corrosion(Loss) Defect/Particle Growth

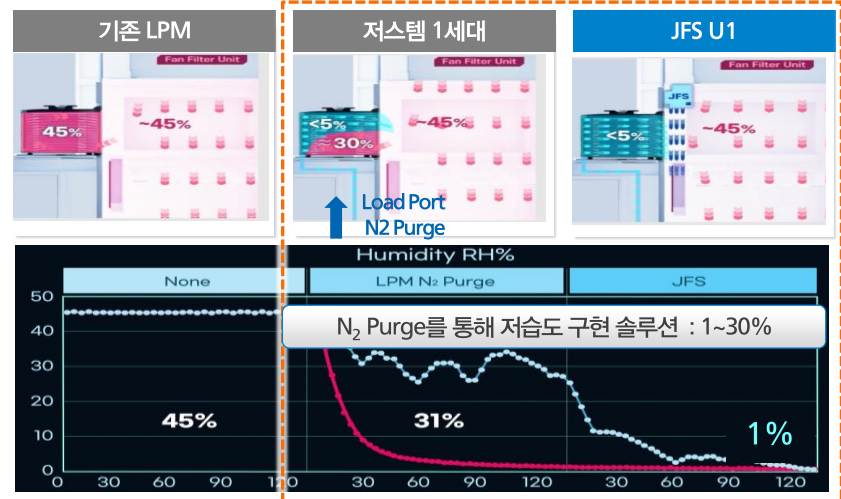
수율 개선 관련 기술적 한계 봉착

저습도 관리 솔루션

N₂ Purge System란?

반도체 웨이퍼 이송 및 보관을 위한 LPM에 핵심 기술인 노즐을 장착 및 개조 후 N₂(질소)를 주입하여 웨이퍼 습도 제어 및 불순물 제거하는 시스템

FOUP 내부 환경 제어를 통해 웨이퍼 품질 및 신뢰성 상승



초미세화 공정 가능 및 생산 수율 향상

제품 포트폴리오

다양한 고객 수요에 대응 가능한 제품 Line-up 구축

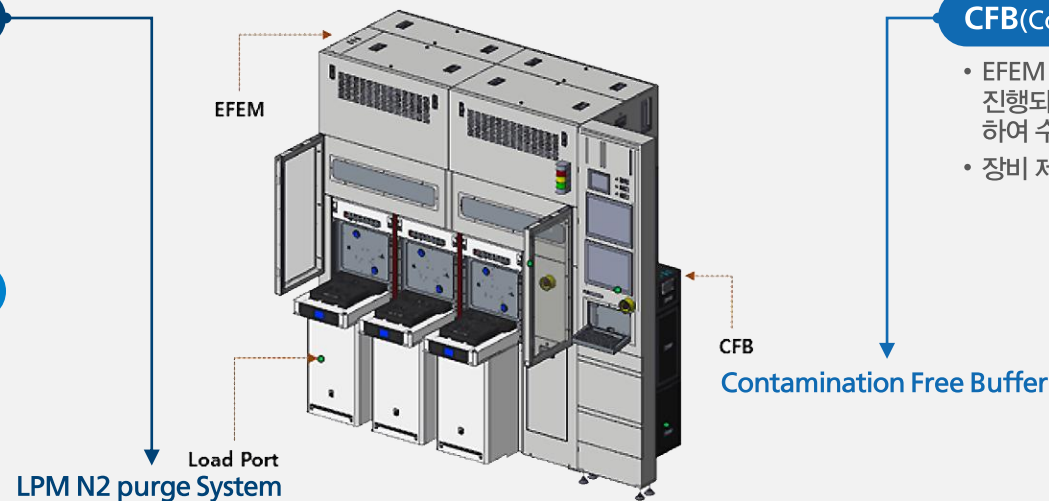
N2 Purge System 제품 소개

N2 Purge LPM

- 반도체 공정 내 매엽식 장비에 장착되는 LPM(Load Port Module)*에 부착 및 개조되어 FOUP 내 환경 제어를 통해 수율을 개선하는 제품

BIP(Built In Purge)

- Batch 타입 반도체 증착 장비에 N2를 Purge 할 수 있는 모듈을 장착 및 개조하여 수율을 향상시키는 제품



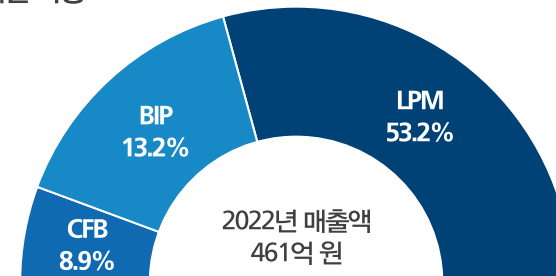
CFB(Contamination Free Buffer)

- EFEM 좌, 우측에 설치되어 공정이 진행되어 오는 웨이퍼에 N2를 Purge 하여 수율을 향상시키는 제품
- 장비 제조사에 공급 추진 중

주요 고객사

N2 Purge LPM	SAMSUNG SK 하이닉스 Micron
CFB	SEMES
BIP	SK 하이닉스 Micron HPSP

주요 제품 매출 비중



반도체 산업 고도화에 따른 수혜



반도체 미세화 트렌드로 저스텝 N₂ Purge System 중요성 증가

수율 개선을 위한 반도체 전공정 습도관리 중요성 부각

AI, 자율주행, 5G 등 미래 산업에 필수적인 반도체 공정 미세화 확대 추세



첨단 미세공정 진행 Fab들의 수율 제어 설비 채택률 증가

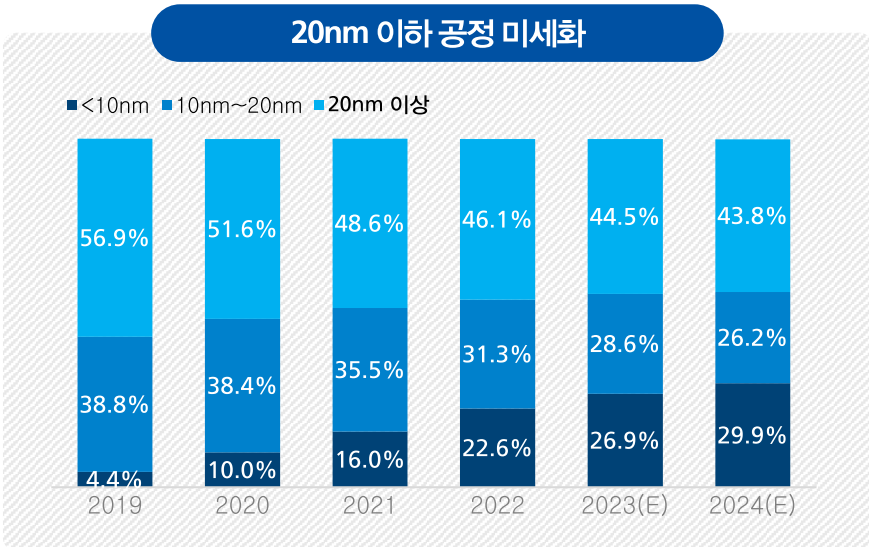
SMIC, UMC 등 중화권 기업들의 공정 미세화 이후 대량 생산이 가능한 수준의 수율 확보 어려움



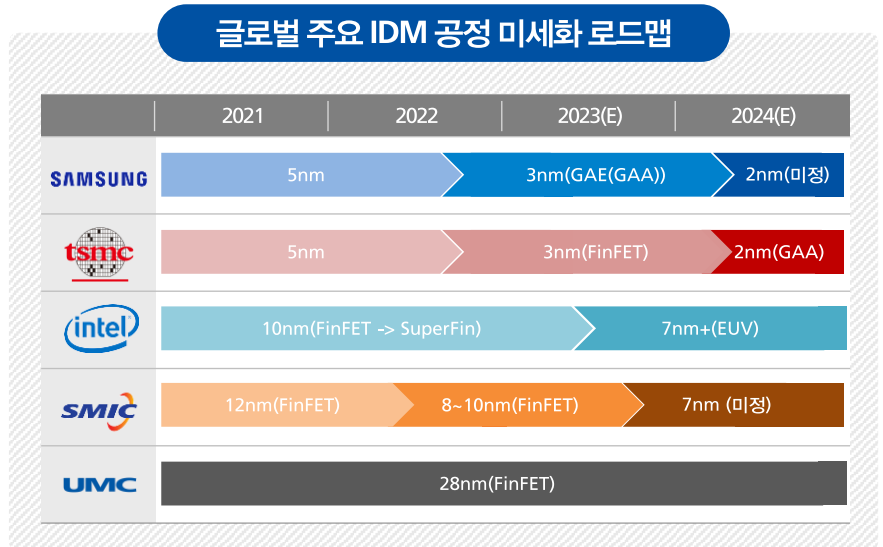
Justem

초미세 공정 확대의 최대 수혜 기업

- 글로벌 MS No.1 습도제어 기업
- 기존 고습도 환경의 한계를 해결한 극한의 습도제어 솔루션 제공 기업



자료 : IC insights



자료 : SK증권, Trendforce, Digitimes

신규 투자에 따른 수혜 전망



세계적인 초미세화 공정 트렌드에 따른 수율 제어 솔루션 수요 증대 -> 메이저 고객사 및 시장 점유율 확대

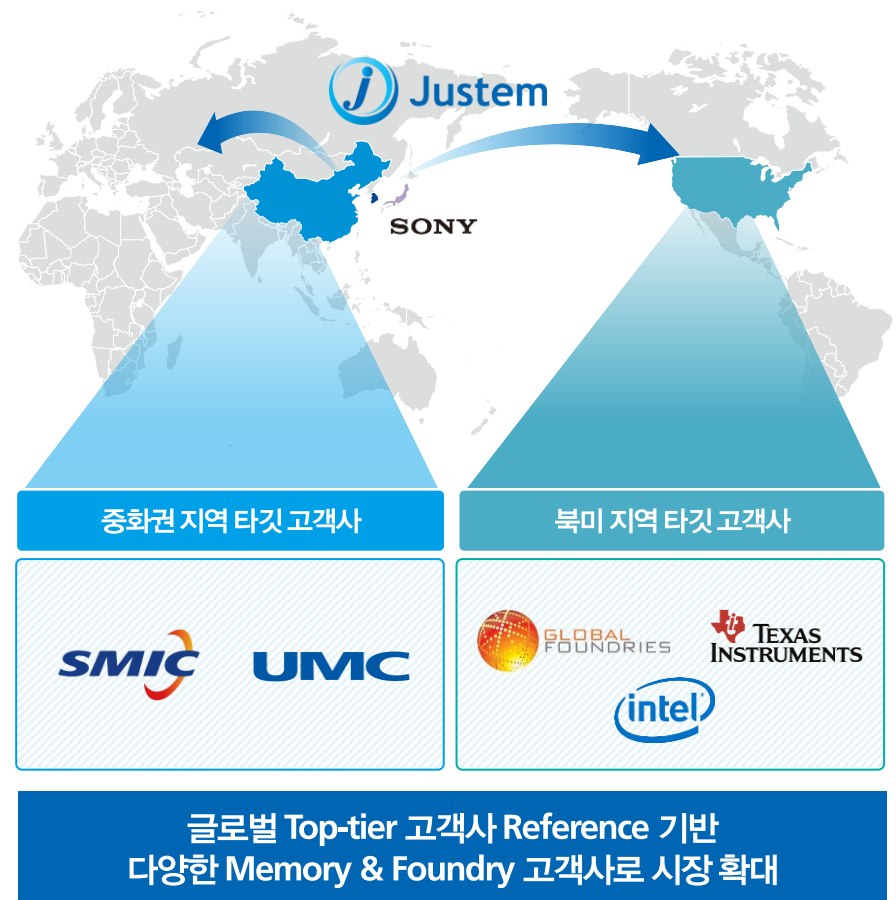
글로벌 주요 IDM 투자 현황

삼성전자	마이크론	SK하이닉스
<ul style="list-style-type: none"> • 평택 4공장 착공 준비 • 미국 Taylor Fab 착공 	<ul style="list-style-type: none"> • 미국, 뉴욕주 • D램 반도체 Fab 2025년 가동 예정 	<ul style="list-style-type: none"> • 한국, 청주 • M15X, M17 등 메모리반도체 Fab
SAMSUNG	Micron	SK 하이닉스
24조 원 투자	21조 원 투자	15조 원 투자

글로벌 IDM 공장 증설에 따른 신규 수주 확대 전망

국내 IDM 고객사 (A社)	국내 IDM 고객사 (B社)	해외 IDM 고객사 (C社)
A공정 파운드리 LSI 제품 수주 지속 가능 (LSI 제품 당사점유 90% 차지)	국내외 다수 공정 내 제품 지속 수주 진행	JFS 공정평가공통 진행 및 양산에 따른 하반기 주 진행 예정

신규 고객사 확보 전략



CREATIVE &
INNOVATION

GLOBAL NO.1 HIGH-TECH SOLUTION PROVIDER



03

Investor Relations 2023

Business Performance

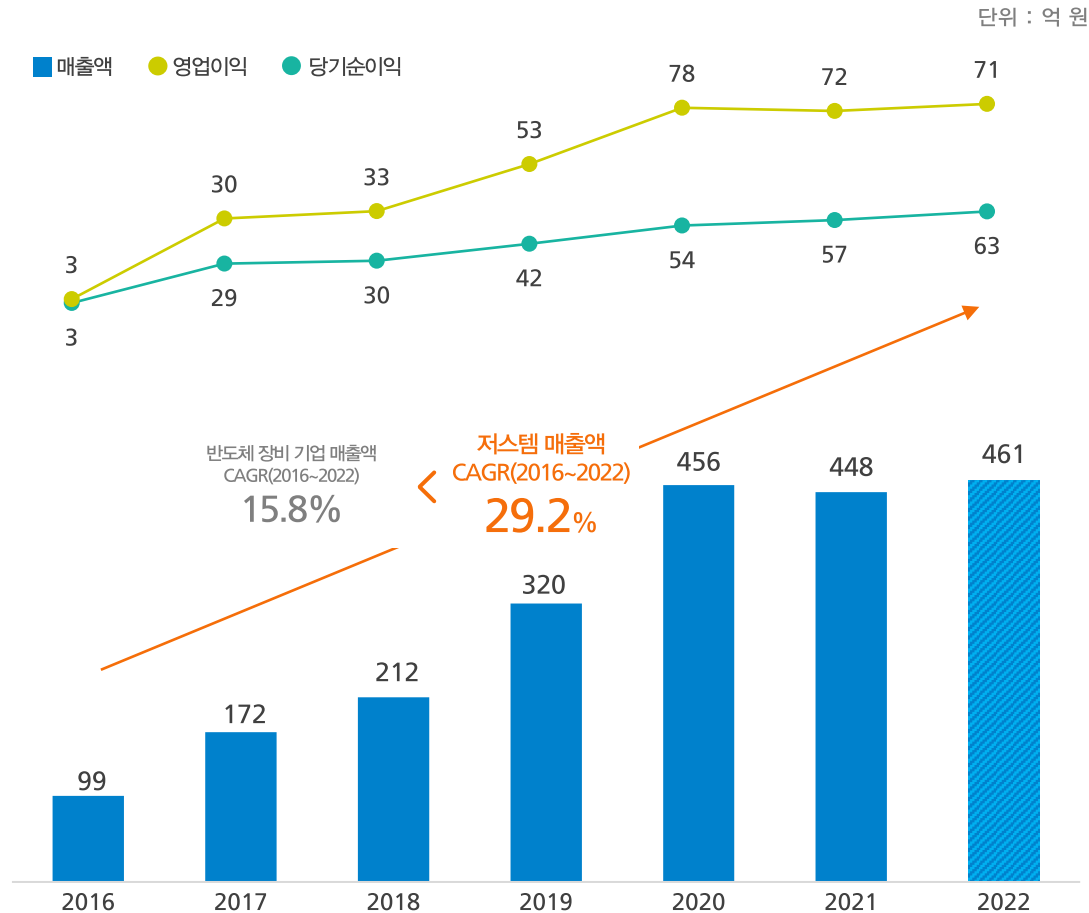
- 01. 경영성과
- 02. 수주 현황

경영성과



기술 경쟁력으로 안정적인 매출 성장세와 높은 이익률 유지
전방 산업 침체에도 불구하고 동사의 수율 제어 솔루션에 대한 니즈 증가로 누적 매출 지속 증가

연도별 매출액 / 영업이익 / 당기순이익 추이



경영성과 주요 요인

2022년 성과 주요 요인

- 하반기 국내 IDM 감산에 따른 일시적 매출 감소
- 시장 내 기술경쟁력으로 두 자릿수 영업이익률 유지
- 해외 BIP제품 횡전개로 '21년比 150% 매출 증가
- 디스플레이 6.5GH 진공 물류 장비 본격 공급

향후 성장요인

- JFS U1, U5 사업화로 성장 모멘텀 확보
- IDM 3社향 동사 1세대 제품 횡전개 확대로 매출 확대
- 디스플레이 산업 내 투자 활성화로 진공물류 / VIS 등 관련 장비 매출증대 예상

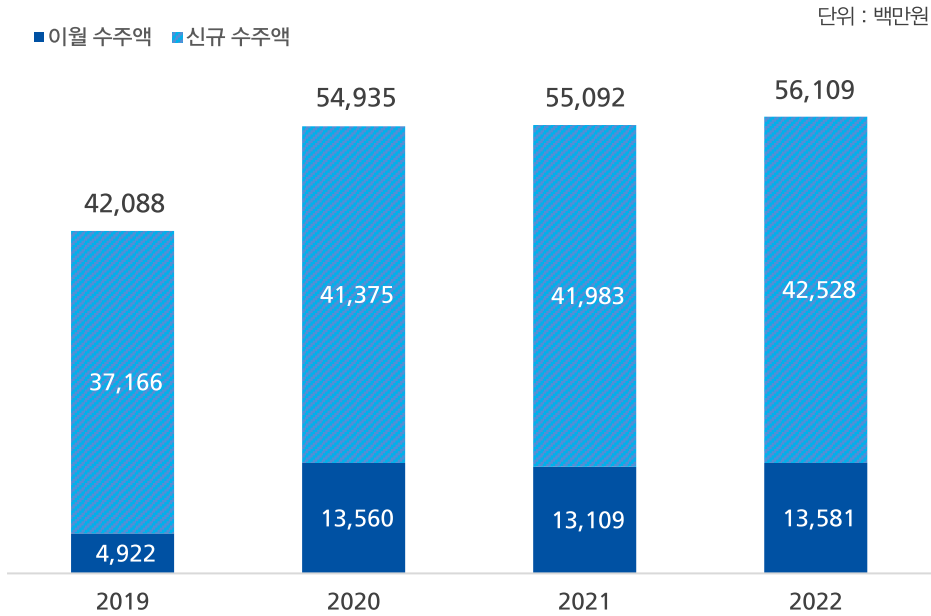
주1: 2022년은 외부감사인의 검토가 완료된 K-IFRS 개별기준
주2: 2021년 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은, 2020년은 감사를 받지 않은 K-IFRS 개별기준
주3: 2016 - 2019년 재무제표는 K-GAAP 개별기준
주4: 반도체 장비 기업 매출액 CAGR은 코스닥 반도체장비 기업 126개社 기준

수주 현황

수주 현황 및 향후 고객사별 대응 전략



연도별 수주 추이



신규 수주 후 빠른 매출 전환율

수주 후 매출인식 소요기간: **약 6주**
 수주 후 매출 전환율: **2021년 기준 78.7%**

신규 Fab 투자 시 예상 수주량

전체 공정 성능개선을 위해
N2 Purge LPM 약 1,950port필요
 *반도체 월 생산량 80,000매 Fab을 가정

사업 확장 전략

신규 시장개척	<ul style="list-style-type: none"> • 해외 신규업체 진입 - 2개社 '23년 내 제품 공급 • 중국시장 진입 • 제습 EFEM 사업화 준비(2023.3Q) • 디스플레이용 제습 EFEM 사업화
매출 증대	<ul style="list-style-type: none"> • 2세대 JFS – 2023.2Q 양산 적용 • IDM 3社별 전략적 제품 황전개 진행 - A社 : JFS U1, U5 - B社 : CFB 진입 - C社 : BIP, CFB 국내수준으로 황전개
경쟁력 확대	<ul style="list-style-type: none"> • 원가경쟁력 10% 확보 • 해외 법인 설립을 통한 서비스 경쟁력 확보 (미국 Taylor PJT, 뉴욕 PJT)

CREATIVE & INNOVATION

GLOBAL NO.1 HIGH-TECH SOLUTION PROVIDER



04

Investor Relations 2023

신규 사업 진행 현황

01. 증장기 성장로드맵
02. 반도체 수율 개선 제품 고도화 현황(1)
반도체 수율 개선 제품 고도화 현황(2)
03. 디스플레이 시장 내 수율 극대화 라인업 구축
04. 태양광 산업 진출 본격화
05. 원천기술기반 신성장 산업 진출
06. 상온 Plasma기술 도입

중장기 성장로드맵

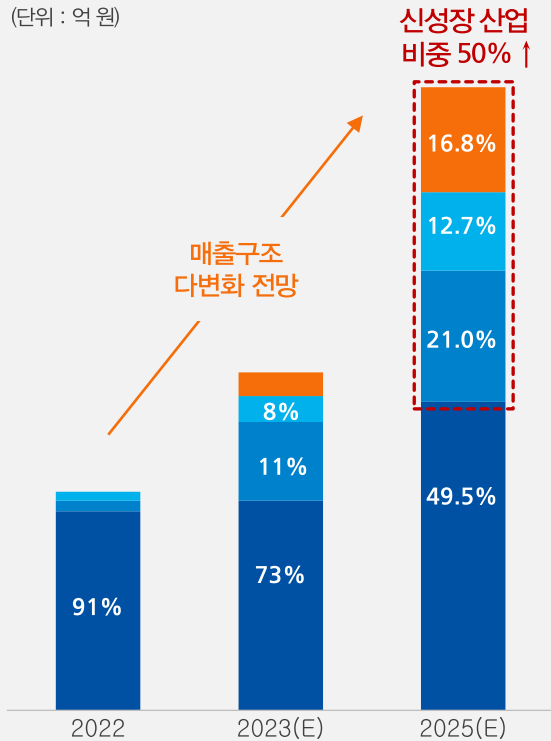


반도체 시장에서 다년간 축적된 기술 경험 기반 고성장 산업으로 확대를 통해 매출 다각화 및 지속 성장

다양한 산업으로 커버리지 확대

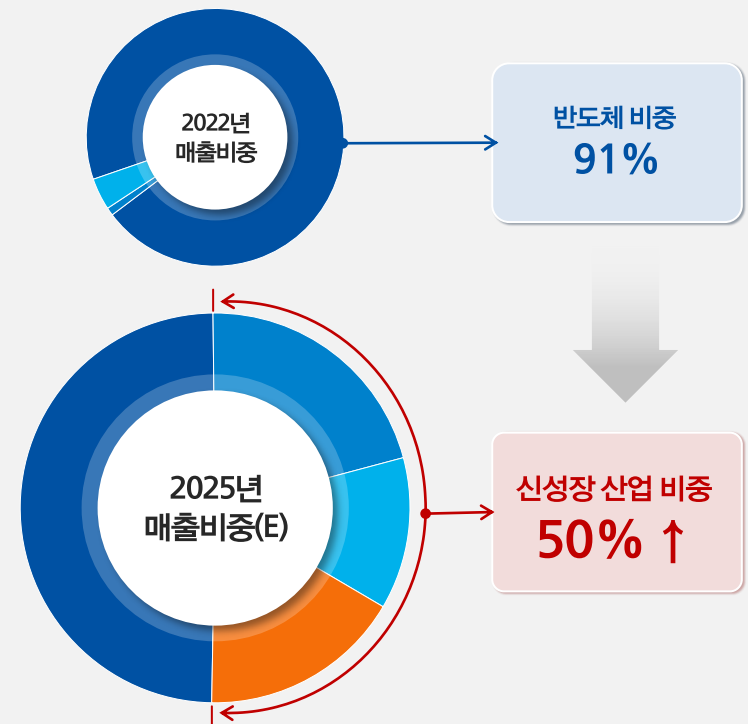
IT 산업 내 Core Tech를 통해 주력 타깃 사업인 반도체에서 디스플레이, 태양광, 2차전지 등 첨단 산업으로 커버리지 확대

(단위 : 억 원)



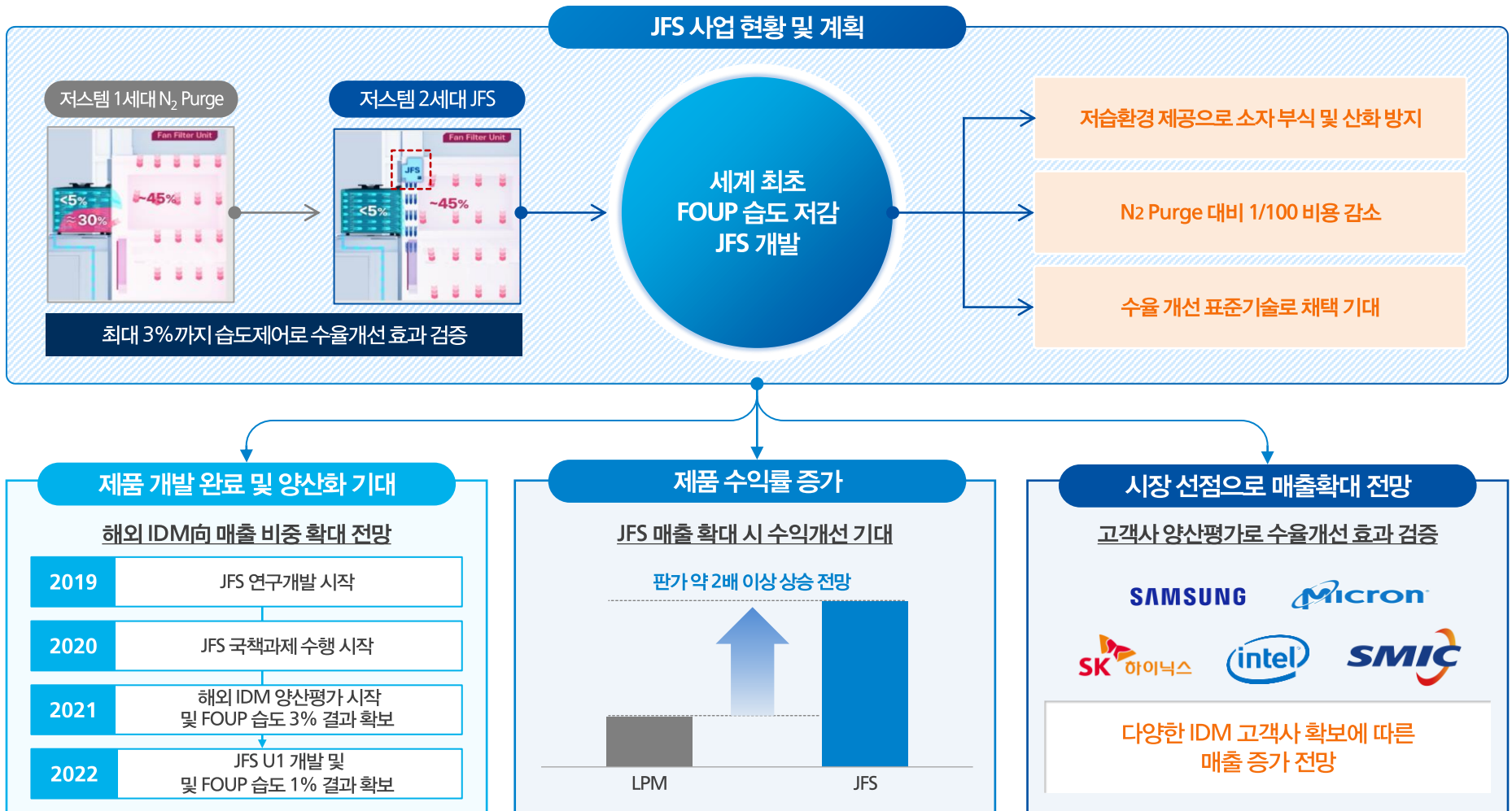
2차전지
세계 최초 적층형 열처리 장비 개발 완료 산업 내 주요 고객사 확보로 2차전지 소재 열처리 시장 선점 전략
태양광
솔라셀용 PECVD, RPCVD, POCL 설비 제조/생산 능력 구축 대면적 공정장비의 양산 대응
디스플레이
OLED 진공 건조 장치 국산화 성공 → OLED 디스플레이 비중 확대에 따른 투자 수혜
반도체
JFS, EFEM 등 제품 고도화를 통해 지속적 수요 확대 및 수익 증대

■ 반도체 ■ 디스플레이 ■ 태양광 ■ 2차전지



반도체 수율 개선 제품 고도화 현황(1)

세계 최초 JFS 개발로 매출확대 및 수익성 향상 기대



반도체 수율 개선 제품 고도화 현황(2)



지속적인 제품 고도화 → 반도체 산업 내 수율개선 부품/장비 핵심 기업으로 성장 기대

반도체 수율개선 핵심 장비기업으로 성장

N₂ Purge System 시장 독점화

저스팀 1세대 N₂ Purge System : JLPX

[반도체 Fab 공정간 웨이퍼 이송 장비]



LPM N₂ Purge System

질소를 활용한 기류제어 방식으로 습도 제어 및 웨이퍼 불순물 제거

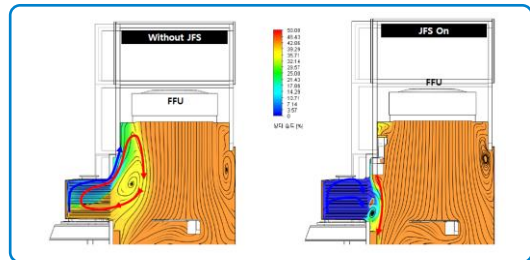
*2022년 반기 기준 누적매출 1,440억원(수출 494억원)

고객사의 니즈 선제파악으로 신규시장 창출

저스팀 2세대 JFS

JFS (Justem Flow Straightener, Zone 습도저감모듈)

세계 최초 기류 제어를 통한 습도관리 시스템



JFS : EFEM으로부터 유입되는 고습도 기류 차단으로 상시 저습도로 제어 가능

저스팀 3세대 JEM 1

JEM 1 (Justem EFEM's Module for 1%, Space습도저감모듈)



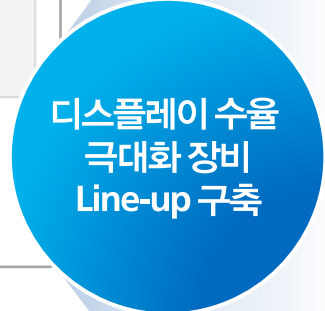
고객 맞춤형 습도 제어, 저전력 제습 시스템 제공
FOUP습도 <1%, 소비전력 최소화, 온도제어 기능

기대효과

- 선제적 제품고도화로 시장 기술 선도
- +
- 국내 EFEM 제품 비중 확대로 국산화 기여
- +
- 반도체 산업 내 시장 점유율 확대

디스플레이 시장 내 수율 극대화 라인업 구축

OLED 시장의 수율개선 필요성 증대로 공정 및 설계기술 기반 시장진출



디스플레이 산업 동향

6G → 8.6G ITOLED 대형화로 신규 투자 기대

: 2stack tandem Cell등 차량 및 IT 기기향
OLED 수요 증가로 신규 투자 발생

OLED 패널 불량관리/수율 향상 중요성 증가

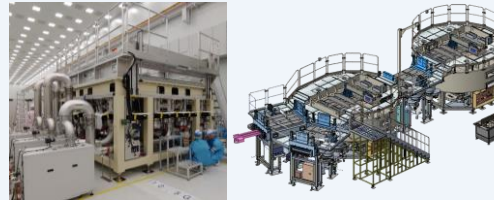
: 수율 개선을 위해 각 공정 이동 간 진공 환경에서의 패널 이송 장비 필수 요구

글로벌 디스플레이 패널 기업들의
OLED 패널 수율 향상 니즈 증가

디스플레이 산업 내 저스팀 사업 경쟁력

- 10.5G급 대면적 고진공 온도 균일도 확보 대형 가공물 신뢰성 해석으로 설계 안정성 검증
- 고객사와 기술 선행 공동개발 협업 진행
- 반도체 분야 수율 제어 기술 레퍼런스 보유

대면적 OLED 제조용 고진공 장비



대면적 고진공 환경용 제조 장치

수분과 산소에 취약한 OLED 패널을 공정 전, 후의 고진공 상태에서 건조/이송/적재 장치

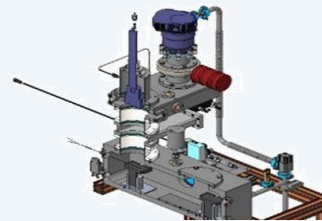
제품 상용화 계획

주요 디스플레이 업체와 공동개발 및 검증 완료



23년 주요 디스플레이 업체향 6GH ~8.6GH 투자 수주 전망

OLED 고진공 이온나이저



OLED 증착공정 수율 극대화 솔루션

고진공 환경내 OLED의 불량을 유발하는 정전기 제거를 위한 제전장치로 OLED 패널 수율 향상을 위한 필수 기술

제품 상용화 계획

주요 디스플레이 업체 현장 평가 진행 중

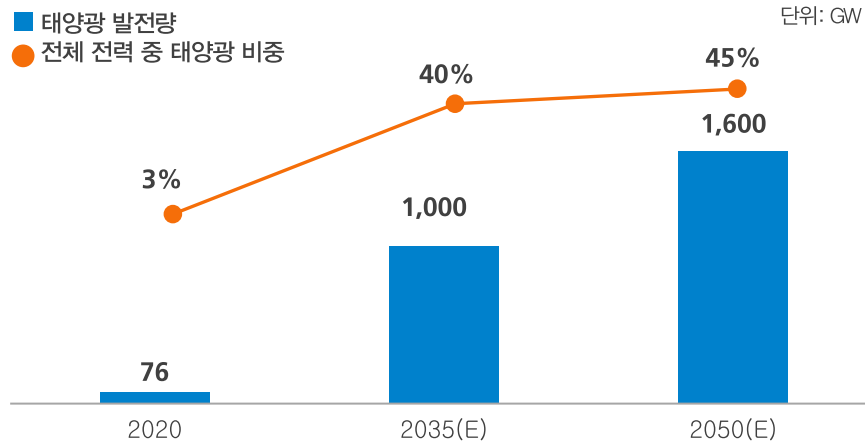


2023년 양산평가 및 상용화 전망

태양광 산업 진출 본격화

신규 기술 기반 태양광 산업으로 매출확대 본격화

미국 태양광 전력 공급량 확대 목표



미국 인플레이션 감축법(IRA) 시행

- 생산(PTC), 투자(ITC), 제품생산(MPC) 관련 세액공제 신설 및
기한 연장과 공제비율 상향

미국 전력요금 상승 및 전력난 우려

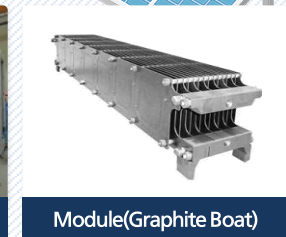
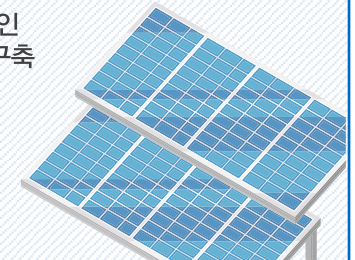
- 자원보호주의 에너지 가격 상승 및 폭염, 한파 등
이상기후로 전력 수급난

미국 에너지 중 태양광 발전 비중
2020년 3% → 2050년 45% 전망

자료: 미국 에너지부

태양광 사업 개요

- 태양광 셀의 효율을 향상시키는 핵심 장비인 PECVD, RPCVD, POCL 설비 생산 능력 구축
- 대면적 공정장비의 양산 경험 보유



태양광 사업 전략 방안

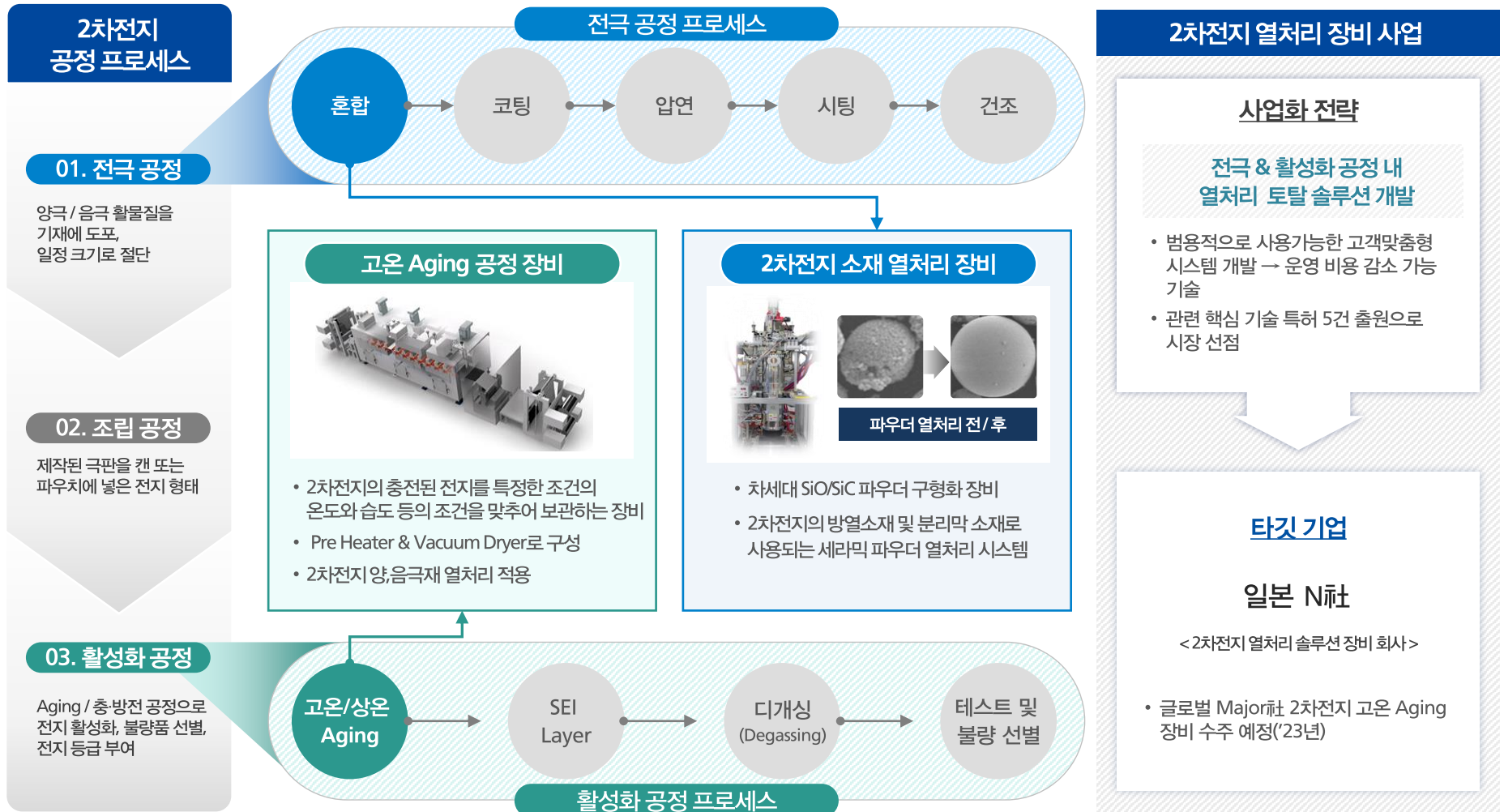
국내 고객사 국내외 site (한국, 미국, 중국, 말레이시아 등) 설비투자 적극 대응
→ 국내 고객사 대형 웨이퍼 생산 라인에 PECVD 수주 예정

국내 태양광 기업과 우호적인 파트너십을 통한
거래선 적극 활용



원천기술기반 신성장 산업 진출

원천기술 활용하여 2차 전지 열처리 장비 시장 진출



상온 Plasma기술 도입

M&A를 통해 플라즈마 기술을 적용한 Cleaning Solution으로 사업 포트폴리오 다각화

기업 개요

1. 회사명: 플람(주)
2. 설립일: 2016년 11월
3. 자본금: 26백만원(2023.3월 기준)
4. 주요 사업 분야: 반도체, 디스플레이 등 산업용 플라즈마 장비
5. 특허: 플라즈마 관련 특허 9건



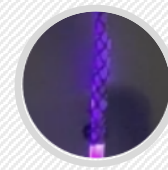
플라즈마 기술 포트폴리오



Multi Plasma



Cold Plasma
(독자 기술)



Surface Plasma



DCSBD Plasma

M&A를 통한 사업 포트폴리오 확장 시너지 창출

디스플레이



- Cold Plasma 기술 기반 OLED 소재 세정 장비(OLED 제조 공정 필수 장비)
- LGD – Panel Edge Cleaner
- 화웨이 – Battery Case Molding 전처리
- Flexble OLED 제조 공정
- OLED Phone 제조 공정

태양광



- Multi Plasma 기술 기반 태양광 세정 장비
- FirstSolar – 태양광 패널 세정 장비

자동차



- 공정가스로 공기를 사용하여 대면적을 세정할 수 있는 유일 장비
- Hirata 자동차 Display Window 제조 장비

경영이념

“ 주주, 직원과 그 가족이 행복한 회사 ”

VISION

지속가능성 및 기업가치제고



CREATIVE & INNOVATION

GLOBAL NO.1 HIGH-TECH SOLUTION PROVIDER



Investor Relations 2023

Appendix

01. 요약 재무제표

재무상태표

단위 : 백만원

구분	2020년	2021년	2022년
유동자산	26,859	18,524	46,332
비유동자산	3,009	25,329	24,153
자산총계	29,868	43,853	70,484
유동부채	14,861	12,621	12,713
비유동부채	554	8,616	6,966
부채총계	15,415	21,237	19,678
자본금	210	2,448	3,536
자본잉여금	-	-	19,712
기타자본	-593	-428	379
이익잉여금	14,837	20,596	27,179
자본총계	14,453	22,616	50,806

주1: 2022년은 외부감사인의 검토가 완료된 K-IFRS 개별기준

주2: 2021년 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은, 2020년은 감사를 받지 않은 K-IFRS 개별기준

손익계산서

단위 : 백만원

구분	2020년	2021년	2022년
매출액	45,578	44,827	46,099
매출원가	25,573	26,288	26,791
매출총이익	20,005	18,539	19,307
판매비	12,223	11,345	12,163
영업이익	7,782	7,194	7,144
금융손익	-1,389	-163	202
기타손익	-31	-410	24
법인세비용차감전순이익	6,362	6,621	7,371
법인세비용	998	889	1,049
당기순이익	5,364	5,732	6,322

주1: 2022년은 외부감사인의 검토가 완료된 K-IFRS 개별기준

주2: 2021년 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은, 2020년은 감사를 받지 않은 K-IFRS 개별기준